



中華民國專利證書

發明第 I 917252 號

發明名稱：可撓式電阻記憶體及其製作方法、高分子材料之製作方法

專利權人：國立勤益科技大學

發明人：蔡沅南、蔡美慧、許仲認、卓葉慈、林永斌

專利權期間：自2026年3月1日至2045年4月21日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



115

年

3

月

1

日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。